

EB 描画装置

メーカー: エリオニクス
型番: ELS-7500YZ

【仕様】

- 電子銃 熱電界放射型
- エミッタ ZrO/W
- 最小描画幅 10nm (カタログ値)
- 最小ビーム径 ϕ 2nm
- 最高描画分解能 1.25nm
- フィールド継ぎ精度 300nm
- 本格 SEM 機能搭載
- 描画基板サイズ ϕ 4”、 ϕ 3”、 \square 2.5”、 \square 20mm、 \square 15mm、 \square 10mm、 \square 5mm



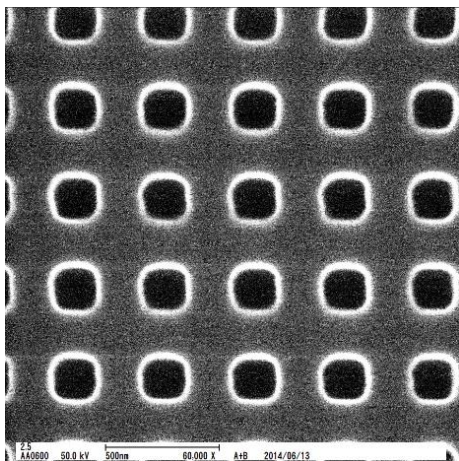
本装置の概要・用途

電子線(EB)描画装置です。EB レジストを塗布した基板などの試料に、微細な電子線を高精度で照射し、超微細パターンを描画します。

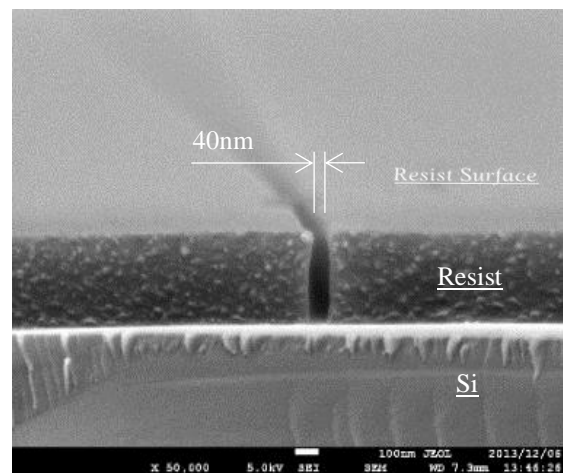
描画するデザインは CAD(AutoCAD や DraftSight 等)の図面として装置に取込みます。SEM と同様の原理で電子線を照射し、CAD データとおりのデザインを EB レジスト上へ描画します。本格的な SEM 機能が搭載されており、描画したパターンの評価も可能です。

本装置で描画した EB レジスト上のパターンは、エッチングや薄膜のリフトオフなどのプロセスに利用することができます。

描画例



ドット(ホール)状デザインの SEM(本装置搭載)写真
(\square 200nm 400nm ピッチ)



デザイン描画後の基板断面 SEM 写真